

## 속보 자료

### 투자자 관계 담당:

Ed Lockwood

전무 이사, 투자자 관계 담당

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

### 언론 관계 담당:

Meggan Powers

전무 이사, 기업 커뮤니케이션

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor, Archer™ 300 LCM Overlay 측정 시스템 출시 1Xnm Half Pitch 메모리 및 2Xnm Logic 프로세스 기술을 목표로 In-Line 모니터링 및 스캐너 자격 검증을 강화하여 고효율적으로 설계됨

캘리포니아주 밀피타스, 2010년 6월 22일 – KLA-Tencor Corporation(NASDAQ: KLAC)은 세계를 선도하는 반도체 및 관련 업계 대상 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 공급업체로서, 오늘 Archer 300 LCM 측정 시스템을 선보였다. Archer 300 LCM은 업계에서 널리 이용되고 있는 이전 세대 제품인 Archer 200에 비해 훨씬 더 향상된 정밀도와 측정 속도를 제공하며, 새로운 In-die 측정 기능이 탑재되어 있다. 이러한 혁신 기술을 지원하는 Archer 300 LCM은 공장 전체에서 종합적인 Overlay 오류 측정 솔루션 역할을 수행하며, 스캐너 자격 검증과 첨단 Logic 및 메모리 제품의 대량 제조를 확실히 제어하는 데 필요한 엄격한 사양을 충족한다. 기존의 Archer 제품에서 업그레이드 가능한 Archer 300 LCM은 고급 프로세스를 위해 경제적이면서도 성능이 뛰어난 Overlay 측정 솔루션을 제공한다.

“193i 리소그래피로의 확장 구현은 임계 공정의 Overlay 오류 허용 범위에 커다란 영향을 주고 있습니다. 특히, Double Patterning 리소그래피를 사용할 경우 32nm 노드에서 허용 가능한 Overlay 오류를 불과 몇 나노미터로 줄여야 할 뿐만 아니라 후속 공정에서도 허용 범위가 크게 축소됩니다. 이러한 제한은 업계에서 전례 없는 수준이라 할 수 있습니다.”고 KLA-Tencor Overlay 측정 부서의 본부장이자 부사장인 Noam Knoll이 설명하였다. “새로운 Overlay 측정 도구인 Archer 300 LCM은 Double Patterning과 그 밖의 까다로운 공정에서 Overlay 오류를 측정하는 데 필요한 엄격한 사양을 충족합니다. 또한 리소그래피 엔지니어들이 웨이퍼 전체에서 보다 많은 측정을 수행하여 이러한 매개변수를 효과적으로 모니터링할 수 있는 경제적인 방법을 고안하였습니다. 즉, 측정 속도를 향상시키는 동시에 die 사이의 영역뿐만이 아닌 die 자체의 내부에 배치된 매우 작은 측정 대상을 사용하는 방법을 결합하였습니다. 무엇보다 중요한 것은 하나의 소형 도구에 이러한 모든 기능이 제공된다는 점입니다. 앞으로 Archer 300 LCM이 첨단 기기에 영향을 주는 까다로운 Overlay 문제를 해결하는 데 있어 큰 도약을 이룰 것이라 믿어 의심치 않습니다.”

Archer 300 LCM에는 칩 제조업체가 저렴한 비용으로 2Xnm Logic 및 1Xnm Half Pitch 메모리 기기를 개발 및 제조할 수 있도록 다음과 같은 몇 가지 기능이 포함되어 있다.

- 광학 시스템의 개선으로 이전 세대인 Archer 200에 비해 정밀도와 TMU(Total Measurement Uncertainty: 총 측정 불확실성 정도)가 보다 엄격해지고 측정 반복성이 향상되었으며 MAM(Move-Acquire-Measure) 시간이 단축되었다.
- 새로운 in-die Overlay 측정 기능을 통해 칩 제조업체가 복잡한 Overlay 보정을 구현함으로써 정확한 패턴 제작이 가능해졌다.
- 업계에서 널리 이용되고 있는 기존의 Archer 도구에서 업그레이드 가능하고 다른 측정 기능에 비해 내장된 확장 기능으로 공장의 자본 투자를 효과적으로 수행할 수 있다.

Archer 300 LCM 시스템은 전세계 주요 메모리 및 Logic 반도체 제조업체로 공급되고 있으며, 개발 및 대량 생산에서 Overlay 응용 분야에 사용된다. 높은 성능과 생산성을 유지할 수 있도록 Archer 도구는 KLA-Tencor 사의 종합적인 글로벌 서비스 네트워크를 통해 지원되고 있다. Archer 300 Overlay 측정 도구에 대한 자세한 내용은 제품 웹 페이지 [www.kla-tencor.com/metrology/archer-series.html](http://www.kla-tencor.com/metrology/archer-series.html) 에서 제공하고 있다.

### **KLA-Tencor 소개**

KLA-Tencor Corporation(NASDAQ: KLAC)은 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 공급업체의 선두 기업으로서 전 세계 고객들과 협력하여 최첨단 검수 및 측정 기술을 개발하고 있다. 이러한 기술들은 반도체, 데이터 스토리지, LED, 광전지 및 기타 관련 나노전자 산업에 사용된다. 업계 표준의 제품 포트폴리오와 세계적인 수준의 엔지니어 및 연구원들로 이루어진 팀을 보유하고 있는 이 회사는 30년 이상 고객들을 위해 우수한 솔루션을 만들어 왔다. 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사를 가지고 있는 KLA-Tencor 는 전 세계적으로 고객 영업 및 서비스 전담 센터를 운영하고 있다. 보다 자세한 정보는 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com) 에서 참조할 수 있다. (KLAC-P)

### **전망:**

기록적 사실 이외에 이 언론 보도 자료에서 발표된 Archer 300 LCM 의 예상 성능 및 반도체 산업에서의 미래 개발과 추세, 관련된 예상 문제, KLA-Tencor 고객의 예상된 Archer 300 LCM 사용, Archer 300 LCM 도구를 다른 측정 기능으로의 확장 가능성, 예상 비용, Archer 300 LCM 도구 사용자가 실현 가능한 운영상 및 기타 혜택 등의 내용은 미래를 전망하는 내용으로, 1995 년의 Private Securities Litigation Reform Act(증권인사소송개혁법)에 따라 제정된 Safe Harbor(면책 규정) 조항의 적용을 받는다. 이러한 전망에 대한 내용은 현재 정보와 예측을 근거로 이루어졌으며 많은 위험성과 불확실성이 수반되어 있다. (비용이나 성능 문제 또는 그 밖의 이유로 인한) 신기술 채택의 지연 또는 KLA-Tencor 제품의 구현이나 사용에 영향을 주는 예상치 못한 기술적 어려움이나 한계를 비롯한 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 위의 진술에서 예측된 것과 크게 다를 수 있다.

###